

{joomplu:1590}В период с 24.09.19 по 26.09.19 в рамках Международного DIGITAL саммита Титовец Д.О. от лица АО «ЭНПО СПЭЛС» и Калашников В.Д. от лица НИЯУ МИФИ приняли участие в 14-й отраслевой научно-технической конференции молодых специалистов Госкорпорации «Росатом» с докладами **«Оценка параметров чувствительности по одиночным радиационным эффектам сбоев при воздействии нейтронов ядерных установок»**

(авторы работы: Д.О. Титовец, В.А. Марфин, Д.В. Бобровский, А.И. Чумаков, А.Б. Каракозов) и

«Влияние повышенной интенсивности набора дозы ионизирующего излучения на стойкость КМОП микросхем»

(авторы работы: В.Д. Калашников, А.Ю. Егоров, А.В. Согоян, А.И. Чумаков, А.Б. Каракозов).

Конференция проводилась в Нижнем Новгороде, и была организована советом молодёжи филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-Исследовательского Института Измерительных Систем им. Ю.Е. Седакова» (далее – НИИИС), администрацией НИИИС при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В рамках конференции была организована работа следующих секций:

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами»,
«Разработка и автоматизация производственных технологических процессов»,
«Микроэлектроника», «Разработка и проектирование радиоэлектронных приборов и систем», «Информационные технологии», «Бережливое производство и производственные системы» и «Техносферная безопасность».